

## 即時發布

### 半導體產業傑出人物 Bala THUMMA（巴拉圖瑪）加入 D2S 擔任副總裁

*Bala Thumma 將負責 D2S 的 GPU 加速像素級曝光量校正 (PLDC) 技術，可提高寫入所有光罩（包括曲線）的圖案保真度和準確性。*

加州聖荷西，美國，二零二四年九月十日—D2S 是半導體製造業 GPU 加速解決方案的供應商，今天宣布，半導體行業傑出人物，Synopsys 前高管 Bala Thumma 已加入該公司，擔任像素級曝光量校正 (PLDC) 副總裁。Bala 擁有超過 25 年的軟體，半導體製造和電子設計自動化 (EDA) 經驗，將推動 D2S PLDC 解決方案的開發和客戶關係。

光罩製造中的 PLDC 技術是一種應用於多重光束光罩刻寫機的技術，它透過操縱單一像素曝光量而不是調整幾何形狀來增強圖案保真度和準確性。這種校正方法改善了邊緣對比度和輪廓，解決了線端縮短和 CD 誤差等問題，而無需將資料轉換回基於邊緣的輪廓幾何形狀。PLDC 在 GPU 上運行，可實現快速處理，使其能夠有效地校正包括傳統曼哈頓圖案在內的任何圖案，但同樣不會增加曲線圖案的運行時間。

D2S 執行長 藤村先生(Aki Fujimura) 表示：“多年來，我很高興在光罩領域與 Bala 合作。他和我有著相似的背景，最初都來自 EDA 布線軟體領域，然後進入半導體製造軟體領域。了解客戶的技術和需求有助於我們更好地服務製造客戶。我期待他的貢獻，不僅能增強我們提供創新解決方案的 ability，還能加速整個半導體行業對光罩製造的認可做出貢獻。”

Bala Thumma 表示：“我很高興加入 D2S，並成為在為半導體製造最先進節點構建工具方面處於創新前沿的團隊的一員。”“PLDC 技術代表了光罩製造領域的重大進步，利用 GPU 加速來提高圖案保真度和準確性。多年來，我認識 Aki Fujimura，他是半導體製造領域的行業傑出人物，我期待與 Aki 和 D2S 才華橫溢的團隊合作，推動這項技術向前發展，確保我們的客戶滿足先進半導體設計不斷增長的需求。”

Bala 在半導體光罩社群中相當知名，他在 BACUS 指導委員會任職超過十年，還曾在曲線格式指導小組任職。在加入 D2S 之前，Bala 在 Synopsys 工作了 20 年，在此期間他擔任了多個重要職位，包括晶片工程組的進階總監，負責 Synopsys 的計算機輔助轉錄系統 (CATS) 軟體產品的開發，該產品是光罩數據處理領域的市場領導者。在他職業生涯的早期，Bala 曾在英特爾(Intel)工作，領導了一

個內部佈線工具的設計、開發和成功部署。在此之前，他曾在 VLSI Technologies 的子公司 Compass Design Automation 從事佈線工作。

Bala 取得了印度瓦朗加爾 (Warangal) 國家理工學院的電子與通訊工程學士學位、南伊芳利諾伊芳 (Illinois) 大學愛德華茲維爾 (Edwardsville) 分校的計算機科學碩士學位，以及亞利桑那州立大學 W. P. Carey 商學院的 MBA 學位。他還擁有多項關於積體電路設計中基於時序的工程變更命令的專利。

D2S, Inc. 公司簡介：

D2S 是為半導體製造業提供用 GPU 加速技術解決方案的供應商。本公司為尖端半導體儀器合作伙  
伴提供可定製的類比技術。D2S 的 TrueMask® 技術，應用其 GPU 計算設計平台 CDP，使得利用曲  
線形狀的先進光罩設計成為可能，並能在所需限定時間內刻寫完畢，以確保最好的晶圓質量和成  
本節省。D2S 是 the eBeam Initiative (電子束倡議團契) 的主辦者和電子製造深度學習中心 (CDLe)  
的創建成員。公司成立於 2007，總部設於加州聖荷西。要獲得更多訊息，請查閱：  
[www.design2silicon.com](http://www.design2silicon.com)。

D2S, the D2S logo 和 TrueMask 是 D2S 公司的註冊商標。

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

Principal

Open Sky Communications

電話: +1.415.519.3915

電郵: [dmoreno@openskypr.com](mailto:dmoreno@openskypr.com)

###